

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



Equipement de dépôt de couches minces PVD en ligne

LINE440



by

allianceconcept

Conçu pour une productivité élevée et une uniformité de l'épaisseur

Bâti de **dépôt de couches minces par défilement horizontal du substrat sous les cathodes**, l'intérêt principal cet équipement est de pouvoir réaliser les opérations de **chargement/déchargement en temps masqué**. Son sas à plusieurs niveaux (jusque 4 positions) permet grâce à un mouvement vertical, d'être ventilé sans perturber le cycle de dépôt réalisé en simultané.

Une position d'activation de surface par etching permet la préparation de la surface avant dépôt. Un chauffage rayonnant peut également être installé sur ce bâti soit au niveau du sas pour aider au dégazage des substrats, soit dans la chambre de dépôt.

Équipement complet muni d'un séquenceur d'étapes de process automatique, la LINE440 saura s'adapter à votre besoin. Nous pouvons également sur demande proposer ce bâti en configuration verticale.



Caractéristiques générales

Diamètre enceinte :	440 mm
Hauteur :	320 mm
Volume :	120 litres
Vide limite (configuration turbo) :	5.10^{-7} mbar ^[1]
Vide limite (configuration cryogénique) :	5.10^{-8} mbar ^[1]
Capacité machine :	4 cathodes 381 x 127 mm
Uniformité planar :	< +/- 3% ^[1]
Dimension substrat :	310 x 400 mm
Activation de surface et chauffage :	Oui
Pilotage machine :	- Gestion des procédés - Traçabilité

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

